

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 974 684 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 26.01.2000 Patentblatt 2000/04

(21) Anmeldenummer: 99113848.8

(22) Anmeldetag: 15.07.1999

(51) Int. Cl.⁷: **C23C 28/00**, C23C 14/06, C23C 14/02, C23C 14/22

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 20.07.1998 DE 19832571

(71) Anmelder: Hauzer Industries B.V. 5916 PA Venio (NL)

(72) Erfinder:
• Trinh, T.T.
6291 BP Vaals (NL)

Van der Kolk, G.J.
 6026 RG Maarheze (NL)

Fleischer, W.
 5988 KG Helden (NL)

Hurkmans, A.P.A.
 5862 AE Geysteren (NL)

(74) Vertreter:

Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München (DE)

(54) Mehrlagenschicht und Verfahren zu deren Herstellung

(57) Es wird eine Mehrlagenhartstoffschicht beschrieben, die aus einem oder mehreren der Metalle Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Cr, Al, Mo und/oder Nitriden, Karbiden, Karbonitriden, Oxiden oder Sulfiden dieser Metalle und/oder deren Legierungen oder Mischphasen und wenigstens einer Schicht mit einem Anteil von mindestens von 5 %-at der Elemente Au oder Ag besteht.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Substrat mit einer nach dem PVD-Verfahren aufgebrachten Mehrlagen-Hartstoffschicht sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen Mehrlagenschicht.

1

Mehrlagen-Hartstoffschichten sind prinzipiell [0002] bekannt und haben sich in der Praxis für verschiedenartige Anwendungsfälle bewährt.

Immer wieder problematisch und demgemäß verbesserungsbedürftig ist vor allem die Korrosionsbeständigkeit derartiger Mehrlagenschichten.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, Mehrla-[0004] gen-Hartstoffschichten zu schaffen, die den mit derartigen Schichten versehenen Substraten bzw. Bauteilen hohe Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit verleihen.

Gelöst wird diese Aufgabe nach der Erfindung [0005] im wesentlichen durch eine Mehrlagen-Hartstoffschicht, bestehend aus einem oder mehreren der Metalle Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Cr, Al, Mo und/oder Nitriden, Karbiden, Karbonitriden, Oxiden oder Sulfiden dieser Metalle und/oder deren Legierungen oder Mischphasen und wenigstens einer Schicht mit einem Anteil von mindestens von 5 %-at der Elemente Au oder Ag.

Das Schichtsystem gemäß der Erfindung [0006] erbringt eine überraschend wirksame Sperrwirkung, die durch werkstoffliche Eigenschaften der verwendeten Metalle sowie die Anwendung eines PVD-Verfahrens bedingt ist, wobei es der spezielle Schichtaufbau mit sich bringt, daß elektrochemische Korrosionsprozesse vermieden bzw. unterbrochen werden und außerdem die Mikroporen der Substratoberflächen und der einzelnen Schichten abgedichtet werden.

[0007] Die Au oder Ag enthaltende Sperrschicht kann sowohl unmittelbar auf der Substratoberfläche vorgesehen als auch in den nachfolgenden Mehrlagenschichtaufbau integriert sein und sogar als Topschicht verwendet werden.

Weitere besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sowie bevorzugte Verfahrensmerkmale zur Realisierung einer Mehrlagen-Hartstoffschicht gemäß der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben und werden in der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert; in der Zeichnung zeigt:

- ein Beispiel für den Schichtaufbau einer Figur 1 erfindungsgemäßen Mehrlagen-Hartstoffschicht, und
- eine für die Durchführung des erfindungs-Figur 2 gemäßen Verfahrens besonders geeignete Beschichtungsanlage in schematischer Darstellung.

[0009] Figur 1 zeigt in schematischer Weise ein Beispiel einer korrosionsbeständigen und verschleißfesten

Mehrlagenschicht nach der Erfindung, wie sie für dekorative Gegenstände und auch allgemein für Bauteile verwendbar ist.

[0010] Die Mehrlagen-Hartstoffschicht nach der Erfindung ist auf einem Substrat aufgebracht, bei dem es sich um Bauteile oder Gegenstände handeln kann, die aus Kunststoff, Aluminium, Zink, Messing, Kupfer, rostfreien Stählen und dergleichen bestehenden können. In bestimmten Anwendungsfällen, z.B. im Falle von Sanitärarmaturen, kann das jeweilige Substrat auch mit 10 einer oder mehreren galvanisch aufgebrachten Schichten, beispielsweise aus Nickel oder Chrom, vorbehandelt sein, bevor die Mehrlagen-Hartstoffschicht aufgebracht wird.

Bevorzugt wird vor dem Beginn der eigentli-[0011] chen Beschichtung ein Metallionenätzvorgang mittels kathodischer Bogenentladung durchgeführt, um eine Verankerungszone zu schaffen, worauf dann die Weiterbeschichtung mittels Sputtering und/oder kathodischer Bogenentladung erfolgt.

Für den Metallionenätzvorgang können die [0012] Metalle Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Cr, Al, Mo, Cu, Ni, Au, Ag oder deren mehrphasige Kombinationen Verwendung fin-

Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist auf [0013] 25 das Substrat eine Schicht aus TiN oder TiAuN aufgebracht, wobei im Falle einer TiAuN-Schicht diese Schicht eine Sperrwirkung entfalten kann, die sich hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit vorteilhaft aus-

[0014] Auf die an das Substrat anschließende Schicht folgt wenigstens eine Schicht aus Cr, Nb und anschließend eine Mehrzahl von Schichten aus CrNbN. Die Topschicht wird, insbesondere wenn es sich um dekorative Gegenstände handelt, von Au oder TiAuN gebildet, wobei jede der Au enthaltenden Schichten mindestens 5 %-at an Au enthält.

[0015] Die Schichtzusammensetzung, die Anzahl der Schichten und die Art der zu verwendenden Topschicht hängt vom jeweiligen Anwendungsfall ab und kann im Rahmen der in den Patentansprüchen angegebenen Möglichkeiten anwendungsbezogen variiert werden.

[0016] Figur 2 zeigt eine bevorzugt zur Durchführung des Verfahrens nach der Erfindung verwendbare Beschichtungsanlage.

[0017] Diese Anlage ist strichliert im geschlossenen Zustand und mit ausgezogenen Linien mit geöffneten bzw. aufgeschwenkten Kammertüren dargestellt. Im geöffneten Zustand sind die Targets besonders leicht und bequem zugänglich. Die Anlage weist fünf Targets 1, 2, 3, 4, 5 auf, wobei die Targets 1 und 2 in einer aufschwenkbaren Kammerwand und die Targets 3 und 4 in der anderen aufschwenkbaren Kammerwand gehaltert sind. Es handelt sich um Rechteck-Targets, die sich bezogen auf die Zeichnung vertikal erstrecken und wahlweise bevorzugt als kathodische Bogenentladungsverdampfer und als unbalancierte Magnetrons betrieben werden können.

10

20

Das bereits angesprochene ABS-Verfahren, [0018] das mit dieser Anlage realisierbar ist, wird im einzelnen in der europäischen Patentanmeldung 90 909 697.6 beschrieben.

[0019] Die Beschichtungsanlage weist neben einer 5Turbomolekularpumpe 6 vor allem einen Substratträger 8 auf, der einerseits um eine zentrale Achse rotiert und andererseits Substrathalter aufweist, die wiederum um ihre Achse rotieren, so daß durch den Vorbeilauf der Substrate vor den verschiedenen Targets die jeweils gewünschte Schichtbildung erfolgen kann.

Bei dem ABS-Verfahren werden die Vorteile [0020] des kathoden Bogenverdampfungsverfahrens mit denen der Kathodenzerstäubung mit dem unbalancierten Magnetron miteinander verbunden. Bei dem anfänglichen Ätzprozeß im Rahmen einer kathodischen Bogenverdampfung wird nicht nur das zu beschichtende Substrat gereinigt, sondern es wird auch durch Ionenimplantation und Diffusion der jeweiligen Metallkomponente im Substrat eine Verankerungszone im allernächsten Bereich zur Substratoberfläche gebildet, die zu einer wesentlichen Steigerung der Haftfestigkeit zwischen der Mehrlagen-Hartstoffbeschichtung und dem Substrat führt.

. Bei der Herstellung des zur Schichtbildung [0021] benötigten Metalldampfes werden die in der Beschichtungsanlage vorgesehenen Targets aus den Metallen Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Cr, Al, Mo, Cu, Ni, Au, Ag bzw. daraus gebildeten Legierungen oder Mischphasen verwendet. Als Target für das Aufbringen von Au oder Ag kann ein Target mit 100 %

[0022] Reinheitsgrad verwendet werden, aber es ist auch möglich, Targets zu verwenden, die aus einer Legierung von Au oder Ag und den bereits genannten Metallen bestehen, so daß der Au- oder Ag-Anteil vorzugsweise nur im Bereich von 50 % und weniger liegt.

[0023] Durch Aktivierung bzw. Zuschaltung der jeweiligen Targets läßt sich die Schichtbildung in der jeweils gewünschten Weise gestalten, und es ist auch problemfrei möglich, den Metallanteil der hergestellten Hartstoffschicht von der Oberfläche des Substrats zur Oberfläche der Beschichtung hin sowohl kontinuierlich als auch in mehrstufiger Weise zu verändern.

[0024] Die hergestellten Mehrlagen-Hartstoffschichten zeichnen sich jedoch stets durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus und es ist ohne Schwierigkeiten möglich, hohe Abriebfestigkeiten und geringe Schichtrauhigkeiten zu erzielen.

Patentansprüche

1. Substrat mit einer nach dem PVD-Verfahren aufgebrachten Mehrlagen-Hartstoffschicht, bestehend aus einem oder mehreren der Metalle Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Cr, Al, Mo und/oder Nitriden, Karbiden, Karbo- 55 nitriden, Oxiden oder Sulfiden dieser Metalle und/oder deren Legierungen oder Mischphasen und wenigstens einer Schicht mit einem Anteil von

mindestens von 5 %-at der Elemente Au oder Ag.

- 2. Substrat nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die einen Anteil von Au oder Ag aufweisende Schicht zwischen der Oberfläche des Substrats und den nachfolgenden Schichten vorgesehen ist.
- Substrat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens eine einen Anteil von Au oder Ag aufweisende Schicht zwischen den aufeinanderfolgenden Schichten der Mehrlagenschicht vorgesehen ist.
- Substrat nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet. daß die einen Anteil von Au oder Ag aufweisende Schicht als Topschicht vorgesehen ist.
- 5. Substrat nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche. dadurch gekennzeichnet, daß die Mehrlagen-Hartstoffschicht auf einer einoder mehrlagigen, auf das Substrat aufgebrachten Galvanoschicht, insbesondere aus Ni oder Cr, vor-
- Substrat nach einem oder mehreren der vorherge-30 6. henden Ansprüche. dadurch gekennzeichnet, daß als Substratmaterial rostfreie Stähle, Kunststoffe, Aluminium, Zink, Messing oder Kupfer vorgesehen sind.
 - 7. Substrat nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Metallanteil der Hartstoffschicht ausgehend von der Substratoberfläche zur Topschicht hin in vorgebbarer, insbesondere kontinuierlicher oder mehrstufiger Weise zunimmt.
- Substrat nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicken der einzelnen Schichten der Mehrlagenschicht zumindest im wesentlichen 50 gleich sind.
 - Verfahren zur Herstellung einer Mehrlagenschicht auf einem Substrat nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche. dadurch gekennzeichnet, daß die Mehrlagenschicht nach dem ABS-Verfahren, nach einem kombinierten kathodischen Bogenentladungs- und Kathodenzerstäubungsver-

fahren oder nach dem kathodischen Bogenentladungsaufdampferverfahren auf das Substrat autgebracht wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Aufbringen einer ersten Teilschicht der Mehrlagenschicht mittels kathodischer Bogenentladung ein Metallionenätzvorgang zur Bildung einer Verankerungsschicht durchgeführt und dabei als 10 Metall Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Cr, Al, Mo, Cu, Ni, Au, Ag oder deren mehrphasige Kombination verwendet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Metallionenätzvorgang die Mehrschichtbildung mittels Sputtering und/oder einer kathodischen Bogenentladung erfolgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß zur Mehrschichtbildung in einer Beschichtungsanlage mit zumindest einfach rotierendem Substratträger mehrere um den Substratträger verteilt angeordnete Targets verwendet werden, die aus verschiedenen Metallen, deren Legierungen oder aus Mischphasen bestehen.

13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Au oder Ag enthaltende Schicht von einem Target mit einem Au- oder Ag-Anteil von 100 % Reinheitsgrad bis 50 % Reinheitsgrad mit einer Zulegierung des jeweiligen Restanteils aus den Metallen nach Anspruch 10 resultiert.

5

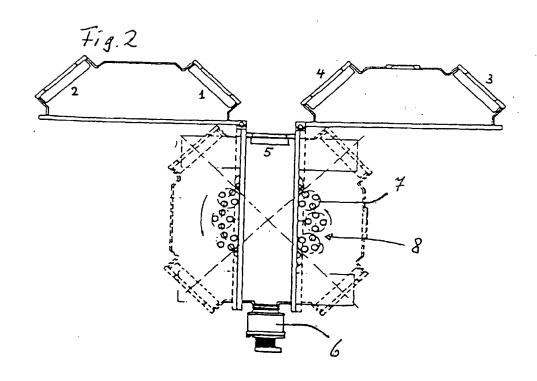
20

35

40

45

50





Europäisches EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldun

EP 99 11 3848

	EINSCHLÄGIGE DO	DKUMENTE			KLASSIFIKATION DER
ategorie	Kennzeichnung des Dokuments der maßgeblichen T	mit Angabe, soweit	erforderlich,	Betrifft Anspruch	ANMELDUNG (Int.Cl.7)
(US 4 898 768 A (RANDH/ 6. Februar 1990 (1990- * Spalte 3, Zeile 28 * Spalte 4, Zeile 9 -	AWA HARBHAJAN -02-06) - Zeile 51 *		1,4-7,9, 12,13 10,11	C23C28/00 C23C14/06 C23C14/02 C23C14/22
(US 4 591 418 A (SNYDE 27. Mai 1986 (1986-05	R JAMES R) -27)		1-6 7-13	
4	* Beispiel 1 *				
X	US 5 234 561 A (BUSKE 10. August 1993 (1993 * Spalte 5, Zeile 65	- Spalte 6,	Zeile 28	1,4,9,	
	* * Spalte 9, Zeile 14 22 *	- Zeile 15;	Abbildung		
X	EP 0 611 833 A (CITIZ 24. August 1994 (1994 * Spalte 1, Zeile 55	1-US-/4)		1,4,6,8	
	* * Spalte 5, Zeile 33 3 *	- Zeile 41;	Beispiel		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7)
X	GB 2 284 431 A (BEIJ COR) 7. Juni 1995 (1 * Beispiele 1,2 *	 ING GREAT WAI 995-06-07)	LL TI GOL	D 1,4	
Y,D	EP 0 404 973 A (HAUZ 2. Januar 1991 (1991 * Ansprüche 1,2 *	ER HOLDING)		10,11	
					,
D	er vorliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentan	sprüche erstell	lt	Profer
_	Recharchenort		tum der Recherche	1	Ekhult, H
200	DEN HAAG	<u> </u>	lovember	- de lies	ando Theorien oder Grundsätze
M 150	KATEGORIE DER GENANNTEN DOR (von besonderer Bedeutung allein betrac von besonderer Bedeutung in Verbindur anderen Veröffentlichung derselben Kate technologischer Hintergrund nichtschriftliche Offenbarung	htet ng mit einer	E: atteres Par nach dem D: in der Ann L: aus andere	Anmeldedatum v neldung angefühi en Gründen ange	ende Theorien oder Grundsätze is jedoch erst am oder eröffentlicht worden ist des Dokument führtes Dokument utfamilie, übereinstimmendes

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 99 11 3848

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

11-11-1999

Im Recherchenbe angeführtes Patentdo	richt kument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichun
US 4898768	Α	06-02-1990	ΕP	0462228 A	
			wo	4 TOLLEO A	27-12-199
			US	5037517 A	23-08-199
UC 4501410					06-08-199
US 4591418	Α	27-05-1986	AU	570602 B	17-03-1988
			AU	3761885 A	01-05-1986
			BR	8500366 A	09-09-1986
		٠,	CA	1211073 A	09-09-1986
			CH	671584 A	15-09-1989
			CN	1003523 B	08-03-1989
		s e	DE	3506623 A	30-04-1986
			FR	2572421 A	02-05-1986
			GB	2166162 A,B	30-04-1986
			- IN	162532 A	04-06-1988
			IT	1184597 B	28-10-1987
			JP.	1724274 C	24-12-1992
			JP	4008503 B	17-02-1992
			JP 	61104069 A	22-05-1986
US 5234561	A.	10-08-1993	KEI	NE	
EP 0611833	Α	24-08-1994	CN	1093892 A	26 10 1004
			DE	69409278 D	26-10-1994 07-05-1998
			DE	69409278 T	23-07-1998
			HK	1009717 A	04-06-1999
			JP	6299334 A	25-10-1994
			SG	38857 A	17-04-1997
			JP	7011462 A	13-01-1995
GB 2284431	Α	07-06-1995	 CN	1089665 A	20-07-1994
EP 0404973	Α	02 01 1001			
E. 04043/3	*	02-01-1991	AT	101661 T	15-03-1994
			DE	3941918 A	03-01-1991
			DE	59004614 D	24-03-1994
			WO	9100374 A	10-01-1991
			EP	0439561 A	07-08-1991
			US	5306407 A	26-04-1994

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82

EPO FORM PO461

Multilayer and method for its manufacture								
Patent Number:	EP0974684							
Publication date:	2000-01-26							
Inventor(s):	FLEISCHER W (NL); TRINH T T (NL); HURKMANS A P A (NL); VAN DER KOLK G J (NL)							
Applicant(s):	HAUZER IND BV (NL)							
Requested Patent:	□ <u>EP0974684</u>							
Application Number:	EP19990113848 19990715							
Priority Number(s):	DE19981032571 19980720							
IPC Classification:	C23C28/00; C23C14/06; C23C14/02; C23C14/22							
EC Classification:	C23C14/06, C23C14/02A2, C23C14/02B2, C23C28/00							
Equivalents:	□ <u>DE19832571</u>							
Abstract								
A PVD multilayer hard material coated substrate, including a silver- or gold-containing layer, is new. A substrate, having a PVD multilayer hard material coating consisting of one or more of Ti, Zr, Hf, Ta, Nb, Cr, Al and Mo and/or their nitrides, carbides, carbonitrides, oxides, sulfides and/or alloys or mixed phases, includes one or more layers containing 5 at. % Au or Ag. An Independent claim is also included for cathodic arc discharge and cathodic sputtering method or by a cathodic arc vapor deposition method. Preferred Features: The silver- or gold-containing layer is provided between the substrate and the adjacent layer, between adjacent layers and/or above the multilayer. The substrate consists of stainless steel, plastic, aluminum, zinc, brass or copper.								
Data supplied from the esp@cenet database - I2								

• ٠.